

四槽円鏡型浮遊帯域溶融装置

型式：FZ-T-4000-H-VIII-VPM-PC



Crystal Systems Corp.

株式会社クリスタルシステム

〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町 9633 番地 1

TEL 0551-36-5271 FAX:0551-36-5273

<http://www.crystalsys.co.jp> e-mail: eigyo@crystalsys.co.jp

1. 装置仕様書

型式	FZ-T-4000-H-VIII-VPM-PC			
使用ランプ種類	ハロゲン			
使用ランプ、ミラー個数	4 (個)			
最高到達圧力	0.95 (MPa)			
最高到達真空度	5×10^{-5} (Torr) (6.7×10^{-3} Pa)			
シャフト部シール方式	磁性流体シール+高圧ベローズ			
最高到達温度	2,200 (°C)			
常用使用温度	1,850 (°C)			
標準具備ランプ	300 (W)			
(各ランプは4本一組、各2組を標準 装備)	1,000 (W)			
円周方向温度差	30 (°C以下)			
ランプ冷却方式	空冷			
ミラー冷却方式	空冷			
石英管シール冷却方式	水冷			
シャフト/ミラーステージ	上下シャフト移動 / ミラーステージ固定			
下シャフト移動長(結晶育成長)	最大移動長 350 (mm) 結晶育成長 150 (mm)			
上シャフト移動長(原料棒供給長)	350 (mm)			
最大原料棒長	150 (mm)			
下シャフト(結晶育成)速度遅送り	0.01~300 (mm/hr)			
下シャフト移動速度早送り	6~150 (mm/min)			
上シャフト移動速度遅送り	0.01~300 (mm/hr)			
上シャフト移動速度早送り	6~150 (mm/min)			
上下シャフト回転速度	5~100 (rpm)			
熔融域観察方式	CMOS カメラ			
雰囲気ガス流量制御	マスフローコントローラー：①Ar 5 (L/min) ②O ₂ 500 (cc/min) フロート式フローメーター：③Air 10 (L/min) (Compressor 付)			
ランプ出力制御方式	プログラム式出力調整 (4本を一括制御)			
出力安定度	入力変動±10 (%)に対して±0.2 (%)以下			
用力	電力	三相 200 (V), 30 (A)		
	冷却水	3 (L/min)		
装置寸法 (mm)	本体	幅	制御盤 (ガス BOX 含む)	
		幅	890	605
		奥行	800	760
		高さ	2,800	1,640

注) 上記仕様は断り無く変更することがあります。 随時、営業担当者にお問い合わせ下さい。

2. 標準付属品

- | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|
| 1) ハロゲンランプ | 最高出力 | 300 (W) | ・ ・ ・ ・ ・ | 8 (本) |
| | | 1,000 (W) | ・ ・ ・ ・ ・ | 8 (本) |
| 2) 石英管 (標準管) | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 (本) |
| | (高圧管) | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 (本) |
| 3) Oリング、バックアップリング (石英管シール) | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | 4 (個) |
| | (シャフトシール) | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | 4 (個) |
| 4) 種子結晶保持治具 | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 (個) |
| 5) 原料棒保持治具 | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | 2 (個) |
| 6) 工具箱 | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | ・ ・ ・ ・ ・ | 1 (箱) |